



一种制备金属钯合金膜的化学共沉积方法

文献类型: 专利

;

作者 徐恒泳;曾高峰;史蕾;安德里斯歌德巴赫

发表日期 2011-04-13

专利国别 中国

专利号 CN200910169510.0

专利类型 发明

关键词 物理化学

权利人 中国科学院大连化学物理研究所

是否PCT专利 是

中文摘要 一种制备钯合金膜的化学共沉积方法,是在化学镀金属钯的过程中将掺杂金属的络合物溶液添加到金属钯的镀液中,而不是在化学镀之前混合。本发明通过控制共沉积镀液中易于被优先还原的金属离子的浓度,从而实现钯和掺入金属同时且均匀地沉积的制备钯合金膜。利用本方法能够一次制备出致密且具有精确目标组成的钯合金膜,有效降低合金膜制备的劳动强度,显著地提高了钯银合金膜制备的成功率和重复率;该方法所得钯合金膜能够成数量级地减少高温合金化时间,节省电能、高纯氢和实验时间,同时也将显著延长合金膜的实际服役时间。

学科主题 物理化学

公开日期 2011-04-13 ; 2011-07-11

申请日期 2009-09-08

语种 中文

资助信息 大连化物所

专利证书号 带填写

专利申请号 CN200910169510.0

专利代理 周长兴

源URL [http://159.226.238.44/handle/321008/106947]

专题 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所

推荐引用方式 徐恒泳,曾高峰,史蕾,等. 一种制备金属钯合金膜的化学共沉积方法,一种制备金属钯合金膜的化学共沉积方法.

GB/T 7714 CN200910169510.0. 2011-04-13.

入库方式: OAI收割

来源: [大连化学物理研究所](#)

浏览

317

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

